

Cesta De Limpieza De Fotomáscaras De 6 Pulgadas Con Doble Asa, Resistente A La Corrosión, Personalizada En Ptfе

Número de artículo: PL-CP05



Introducción

Los soportes de limpieza de fotomáscaras de 6 pulgadas con doble asa, personalizados y de alto rendimiento fabricados en PTFE ofrecen una resistencia química incomparable para procesos húmedos en semiconductores y laboratorios. Estas cestas duraderas garantizan una manipulación segura de las muestras, un drenaje rápido y una limpieza sin contaminación en ácidos y disolventes agresivos.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Limpieza RCA para semiconductores	Inmersión secuencial de obleas de silicio en soluciones SC-1 y SC-2 para eliminar contaminantes orgánicos y metálicos.	La resistencia total a agentes oxidantes y ácidos a alta temperatura garantiza que el portador no se degrade.
Ataque químico de fotomáscaras	Sujeción de fotomáscaras de 6 pulgadas durante la eliminación de cromo u otras capas bloqueadoras de luz mediante atacantes agresivos.	La posición segura evita la vibración de la máscara, garantizando una transferencia de patrón de alta fidelidad y cero arañazos en la superficie.
Texturizado de células solares	Proceso de creación de micropirámides en superficies de silicio mediante mezclas de KOH o HF/HNO3 para mejorar la absorción de luz.	El diseño duradero de doble asa permite una manipulación segura en entornos industriales de gran volumen y tanques profundos.
MEMS y microfluidos	Limpieza y ataque de sustratos de vidrio o silicio utilizados en la fabricación de Sistemas Microelectromecánicos.	La pureza del material evita la introducción de impurezas traza que podrían interferir en el funcionamiento de dispositivos a microescala.
Material de laboratorio para análisis de trazas	Sujeción de vasos de precipitación, tapas o componentes pequeños durante la limpieza por vapor de ácido especializada o remojo.	La ausencia garantizada de iones metálicos (libre de iones) lo convierte en el estándar de oro para el soporte de análisis de elementos ultratraza.
Preparación de vidrio conductor	Limpieza de sustratos de vidrio recubiertos de ITO o FTO para investigación de células solares de OLED o perovskita.	El diseño de rejilla permite un contacto completo del fluido con la capa conductora al tiempo que protege los bordes del sustrato.
Revelado químico húmedo	Transporte de obleas recubiertas de fotorresina expuestas a través de soluciones reveladoras en flujos de trabajo de litografía.	La estabilidad química en diversos reveladores orgánicos garantiza resultados consistentes y cero interacción con el material.

Parámetro	Detalles de especificación (Modelo: PL-CP05)
Material principal	Politetrafluoroetileno (PTFE) virgen de alta pureza al 100%
Compatibilidad de sustratos	Fotomáscaras, obleas o vidrio estándar de 6 pulgadas (152,4 mm)
Configuración de asas	Soporte reforzado de doble asa para elevación vertical equilibrada
Resistencia a temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Compatibilidad química	Universal (Todos los ácidos, bases, disolventes orgánicos y soluciones piranha)
Configuración de ranuras	Ancho de ranura, paso y capacidad total personalizables (estándar 10/25 ranuras)

Aplicación	Descripción	Beneficio principal
Parámetro	Detalles de especificación (Modelo: PL-CP05)	
Características estructurales	Base de rejilla mecanizada por CNC para drenaje rápido; puntos de contacto con la muestra redondeados	
Acabado superficial	Superficie de PTFE mecanizada lisa y no porosa (Baja fricción)	
Altura de las asas	Personalizable para adaptarse a profundidades específicas de tanques de limpieza	
Contenido metálico	Cero (Construcción sin metales)	